

вением намагниченности и темп-ры Кюри при изменении состава сплава, аномальной температурной зависимостью намагниченности насыщения и др.

Малые значения КТР И. с. обусловливают их широкое применение в технике и промышленности: в микроволновой технике, приборостроении, часовой промышленности, измерит. технике, вакуумной технике, автоматике, лазерной технике, кораблестроении и т. д. В то же время ферромагн. И. с. не могут быть использованы в качестве материалов для деталей, намагниченность к-рых может вредно сказаться на их работе (напр., держателей головок в видеомагнитофонах, теневых масок в телевиз. приемниках).

В 1972 были открыты т. н. немагнитные И. с.— антиферромагн. сплавы Сг с небольшими добавками Fe и др. элементов. Установлено также, что инвариантными свойствами обладают нек-рые редкоземельные ферро- и ферримагнитные сплавы (напр., ферримагн. сплав $Gd_xY_{1-x}Co_2$ в фазе Лавеса).

Малые значения КТР И. с. обусловлены тем, что обычное («дебаевское») тепловое расширение компенсируется у этих сплавов сокращением размеров, связанным с большой спонтанной магнитострикцией.

Отличие И. с. от обычных магнитупорядоченных сплавов, у к-рых аномалии теплового расширения проявляются в узкой области около точки Кюри (Неселя), заключается в том, что в И. с. эти аномалии наблюдаются во всём температурном интервале существования магн. упорядочения.

Аномальные физ. свойства И. с., возможно, связаны с сосуществованием в этих сплавах ферромагнитно и антиферромагнитно упорядоченных спиновых подсистем. Темп-ры магнитных фазовых переходов каждой из этих подсистем в парамагн. фазу различны. Из-за обменного взаимодействия между ферро- и антиферромагн. подсистемами в И. с. в температурном интервале между их точками переходов в парамагн. фазу происходит следующее. Магн. подсистема, имеющая более низкую темп-ру фазового перехода, не становится при переходе полностью разупорядоченной. Эта спиновая подсистема остаётся в нек-ром промежуточном состоянии между магнитупорядоченным и полностью разупорядоченным состояниями, аналогичном состоянию однофазной магнитупорядоченной системы вблизи темп-ры Кюри. С др. стороны, это же обменное взаимодействие приводит к тому, что др. спиновая подсистема, имеющая более высокую темп-ру фазового перехода, тоже находится в нек-ром частично разупорядоченном состоянии.

Сочетание этих факторов приводит к появлению в широком температурном интервале аномалий физ. свойств, аналогичных аномалиям, наблюдаемым в однотиповых магнитупорядоченных системах только вблизи темп-ры Кюри или Неселя.

Лит.: Роде В. Е., Роль обменного взаимодействия между ферро- и антиферромагнитными компонентами железоникелевых инвариантных сплавов, «Изв. АН СССР. Сер. физич.», 1980, т. 44, с. 1386; Захаров в. А. И., Физика прецизионных сплавов с особыми тепловыми свойствами, М., 1986. **В. Е. Роде.**

ИНВЕРСИОННЫЙ СЛОЙ— слой у границы полупроводника, в к-ром знак осн. носителей заряда противоположен знаку осн. носителей в объеме полупроводника. Образуется у свободной поверхности полупроводника или у его контакта с диэлектриком, металлом или др. полупроводником (см. Гетеропереход). Образование И. с. обусловлено воздействием на поверхность нормального к ней электрического поля, к-рое, согласно зонной теории, приводит к изгибу зон вблизи поверхности (см. Поля эффект). Если, напр., в полупроводнике *p*-типа искривление таково, что уровень Ферми ϵ_F становится ближе к дну зоны проводимости ϵ_c , чем к потолку валентной зоны ϵ_v , то вблизи поверхности образуется И. с., в к-ром концентрация электронов больше концентрации дырок (рис. 1, а).

И. с. всегда изолирован от осн. объема полупроводника **запорным слоем**. И. с. у границы раздела полупроводник—диэлектрик (вакуум) изолирован с обеих сто-

рои и аналогичен тонкой полупроводниковой плёнке, в к-рой в качестве осн. носителей выступают неосн. носители в объеме. В случае гетеропереходов И. с. изолирован запорными слоями с обеих сторон — один из них в «своем», а другой — в «чужом» полупроводнике. С помощью внешн. электрич. поля можно управлять

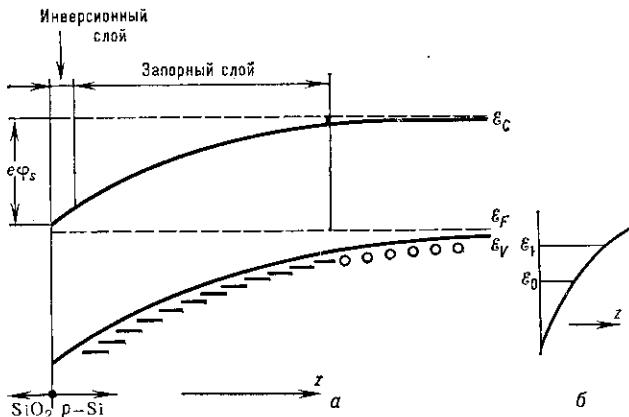


Рис. 1. а — Зонная диаграмма полупроводника *p*-типа (*p*-Si) вблизи границы с диэлектриком (SiO_2); инверсионный слой толщиной d имеет проводимость *n*-типа; ϵ_c — дно зоны проводимости, ϵ_v — вершина валентной зоны, Φ_s — поверхностный потенциал электрич. поля, ϵ_F — уровень Ферми; б — Потенциальная яма для электрона при $\Phi_s > 0$; ϵ_0 , ϵ_1 — уровни энергии электрона.

концентрацией носителей в И. с. на единицу площади поверхности и его эф. толщиной d . Источники этого поля — заряды, внедрённые в диэлектрик, слой, напесённый на полупроводник или заряд спец. полевого электрода, изолированного от полупроводника тонким диэлектрич. слоем (см. МДП-структура; рис. 2).

Приближённое условие образования И. с. для рис. 1, а имеет вид:

$$|E_s| \geq \frac{\epsilon g kT}{el_D},$$

где E_s — напряжённость электрич. поля на поверхности, ϵ_g — ширина запрещённой зоны, l_D — дебаевский радиус экранирования в объеме полупроводника,

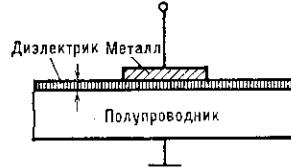


Рис. 2. МДП-структура.

T — темп-ра, **e** — заряд электрона. Типичные толщины И. с. с вырожденным газом носителей $d \sim 40-100 \text{ \AA}$ (толщина запорного слоя 10^3-10^4 \AA).

В случае гетероперехода часть носителей из объема одного полупроводника проникает через барьер в другой, уравнивая ϵ_F в объеме обоих. В результате переноса заряда создается внутри электрич. поля, приводящее к изгибу зон и образованию потенциальной ямы.

Электрическое квантование. Ограниченностю И. с. в направлении нормали к поверхности приводит к квантованию энергии движения носителей:

$$\epsilon = \epsilon_i + \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}, \quad (*)$$

где $i=0, 1, \dots$ — целые числа, k — волновой вектор в плоскости И. с., m^* — эффективная масса носителей заряда (для простоты изотропная в плоскости И. с.). Из (*) видно, что каждое ϵ_i является дном i -й электрич. подзоны.